Electronic Journal 第2248回 Technical Seminar

UV-LED製造技術の現状と将来展望 徹底解説

~ 面発光技術やMEMS/バイオへの応用までを詳解~

主催:電子ジャーナル

日時:6月2日(月)13:00~16:40

講師:ナイトライド・セミコンダクター(株) 代表取締役 村本宜彦氏

会場:連合会館(東京・御茶ノ水)

参加費:39,800円(テキスト代/喫茶代/消費税含む)

定員:30名 定員になり次第、締め切らせて頂きます。お早めにお申込み下さい。

紫外線領域の光を発するLED(UV-LED)は、主にUVキュア(紫外線硬化)アプリケーションに使用されています。既存の水銀ランプに比べ、コンパクトかつ低ランニングコストなことから、着実に市場を拡大させています。また、水銀を含まないことから、環境負荷も少ないデバイスであり、センサや空気清浄、露光、照明、医療、バイオ、MEMSなど幅広い分野での活用が計画されています。市場拡大に伴い、UV-LEDの研究開発は急激に加速していますが、効率、寿命、コストなどの課題を完全に克服するには至っていません。特に露光用などでは、平行光を得やすくするため大面積でのUV発光を求めるニーズが高まっています。しかし、LEDのチップサイズは、300 × 300 μ mから、大きくても1 × 1mmサイズが一般的です。これ以上面積を大きくすると放熱が難しくなり、電流を沢山流しても大きな出力を得ることが難しいためです。本セミナーでは、1.05 × 1.05mmサイズのLEDを銅製基板上に高密度実装して最大50W(波長380nm)の面発光を世界で初めて実現したナイトライド・セミコンダクター 代表取締役の村本宜彦氏に、LEDの基礎から、UV-LEDの発光原理や特徴、今後の技術ロードマップ、応用展開や将来展望までを、分かりやすく、かつ詳細に解説していただききます。

《プログラム》

【13:00~15:10】 発光ダイオード (LED) の基礎と特徴

- 1. はじめに
- 2. LEDの基礎
 - 2.1. LEDの発光原理 2.2. 化合物半導体の材料
- 3. 製造工程

3.1. エピタキシャル成長 3.2. チッププロセス加工 3.3. パッケージ

UV-LEDの基礎と特徴

- 1. 青色LEDの発光原理
 - 1.1. サファイア基板 1.2. インジウム組成不均一 1.3. ELO技術
- 2. UV-LEDの発光原理
 - 2.1. 結晶構造 2.2. チップ構造 2.3. パッケージ

【15:20~16:30】 UV-LEDの現状と発光技術

- 1. 世界最高出力UV-LEDの発光技術
 - 1.1. 波長380nmで最大50W達成

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-18-7 千恵ビル TEL 03-5373-1434 FAX 03-5373-1447 E-mail: narisawa@electronicjournal.co.jp



株式会社 電子ジャーナル

- 1.2. 10×210mm世界最大面積チップ
- 2. UV-LEDの応用
 - 2.1. 光センサ 2.2. 光空気清浄 2.3. 光樹脂硬化 2.4. 半導体露光
 - 2.5. 白色LED照明 2.6. 医療、バイオ、MEMS etc.
- 3. 課題と将来展望

【16:30~16:40】名刺交換会

E-mail: narisawa@electronicjournal.co.jp